

平成 26 年 2 月 12 日

各位

静岡大学共同研究プロジェクト

「電子状態及び電子放出機構解明に基づく極限画像デバイス用低仕事関数電界電子放出源の研究」研究会のご案内

下記のように研究会を開催いたしますので、多数ご参加くださるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

電子工学研究所教授 中本正幸 (内線 1306)

秘書 佐和由美

記

静岡大学共同研究プロジェクト

「電子状態及び電子放出機構解明に基づく極限画像デバイス用低仕事関数電界電子放出源の研究」研究会

日時： 2014 年 2 月 15 日 (土) 16 日 (日)

場所： 静岡大学電子工学研究所 2 階会議室

2 月 15 日 (土)

- | | |
|-----------------|---|
| 13 : 25~13 : 30 | 開会の挨拶
中本正幸 (静岡大学) |
| 13 : 30~14 : 20 | 「炭素系材料の電子放出機構の微視的検討」
佐々木正洋 (筑波大学) |
| 14 : 20~15 : 10 | 「遷移金属炭化物・窒化物の仕事関数の炭素・窒素欠陥依存性」
吉武道子 (物質・材料研究機構) |
| 15 : 10~16 : 00 | 「過酷環境に適した炭素系電界放出源」
中本正幸、文宗鉉 (静岡大学) |

16 : 00~16 : 30 討議

2 月 16 日 (日)

10 : 00~10 : 50 「窒化ハフニウム薄膜の仕事関数とその電子放出特性」
後藤康仁 (京都大学)

10 : 50~11 : 30 討議

以上